

軟X線分光による有機半導体の化学状態解析

○菊間淳、夏目穂、室麻衣子、瀬戸山寛之*

旭化成（株）基盤技術研究所、*九州シンクロトロン光研究センター

有機半導体はプリンタブルエレクトロニクス用途として注目されているが、中でも 6, 13-Bis(triisopropylsilyl)pentacene (TIPS-Pen、図 1) は有機溶剤に可溶であり、簡便な印刷手法で電子回路を作製することが検討されている。一方、有機半導体は光や酸素、水分等により劣化しやすいという課題もあるため、そのメカニズムを明らかにすることは耐劣化材料を開発するうえで重要である。本研究では TIPS-Pen およびその劣化物の XPS 値電子帯スペクトルを第一原理計算により解釈し、その劣化メカニズムを推定することを目的とした。

TIPS-Pen は 124~127 °C で結晶相転移（可逆変化）し、261~266 °C で溶解して不可逆な化学変化が起こることが報告されている。そこで、TIPS-Pen 粉末を 150 °C、300 °C まで N₂ 下、空气中でそれぞれ加熱したものについて、SAGA-LS の BL12 にて値電子帯 XPS および NEXAFS スペクトルの測定を行った。エネルギー一バンド計算は第一原理計算ソフト、CASTEP (Accelrys 社) を用いて、構造最適化した TIPS-Pen の結晶構造を基に状態密度 (DOS) を計算した。また、図 2 に示す酸化劣化のモデル構造についても計算を行い、実測スペクトルとの比較を行った。

図 3 上段に各試料の値電子帯 XPS スペクトルを示す。加熱劣化による値電子帯スペクトルの形状変化が観測された。図 3 下段には、第一原理計算により求めたスペクトル（未劣化、劣化モデル 1, 2）を示す。観測された変化をよく再現しているのは、劣化モデル 2 であることから、劣化によりイソプロピル基が脱離し、酸化するというメカニズムが推定された。別途実施した XPS 内殻スペクトルの結果もこの結果を支持するものであった。

C-K 殻吸収端の NEXAFS スペクトルからは、2 量体化を示唆する変化も観測された。

詳細については当日議論する。

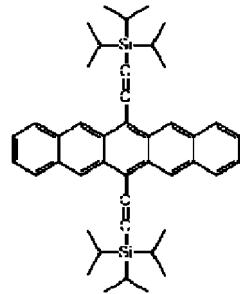


図 1 TIPS-Pen の化学構造

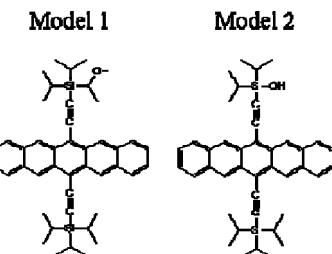


図 2 TIPS-Pen 加熱劣化部位のモデル

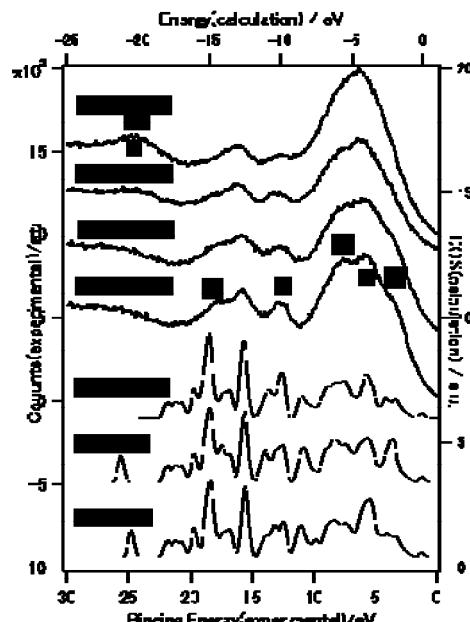


図 3 TIPS-Pen 加熱劣化試料の値電子帯 XPS スペクトル

九州シンクロトロン光研究センター 合同シンポジウム
AsahiKASEI

軟X線分光による 有機半導体の化学状態解析

軟X線分光法と第一原理計算による TIPS-Penの加熱劣化解析

2014年8月5日
旭化成（株）基盤技術研究所
菊間 淳

共同研究者
旭化成：夏目様、室麻衣子
SAGA-LS：瀬戸山寛之

接続番号：
1302002GT, 1305046G

Outline
AsahiKASEI

- 背景と目的
- 実験および計算方法
- 未劣化品の解析
(シミュレーションの妥当性)
- 加熱劣化解析と推定メカニズム
- まとめと今後の展望

1. 背景・目的
AsahiKASEI

TIPS-Pen: 6, 13-Bis(triisopropylsilyl)pentacene

- 利点** 有機溶剤に可溶な有機半導体
→ プリンタブルエレクトロニクス用途として注目
- 課題** 光や酸素、水分等により劣化しやすい
→ 劣化メカニズムを明らかにすることは耐劣化材料を開発するうえで重要

価電子帯の電子は、化学結合状態に直接関与。
⇒ 化学状態の情報を豊富に含む。
⇒ 価電子帯XPS、NEXAFSを用いて、劣化による構造変化を明らかにしたい。

しかし... 4

AsahiKASEI

しかし、一般に、価電子帯XPS、NEXAFSスペクトルは解説が難しい... .

実験 ◇軟X線放射光（SAGA-LS）による、高精度、高S/Nな
価電子帯XPS および C、OのK吸収端NEXAFS

計算 第一原理計算による価電子帯および非占有バンドの構造を計算。

本検討

- ①未劣化のTIPS-PenのXPS価電子帯スペクトルを第一原理計算により再現できるかを検証
- ②TIPS-Penを熱劣化させた際のメカニズムを検討

5

2. 実験 および 計算方法
AsahiKASEI

試料

TIPS-Pen粉末 (Sigma-Aldrich, >99%) → クロロベンゼンに溶解
⇒ スピンコート膜
未劣化試料

加熱 (TG/DTA装置: 10°C/min.)
150°C(N2 or Air) ⇒ 溶解し、スピンコート
300°C(") ⇒ 融解膜をそのまま測定 加熱劣化試料

価電子帯XPS
SAGA-LS BL12 $h\nu = 70 \text{ eV}$ (150 eV)
NEXAFS

内殻XPS
Al K α (1486.6 eV)

6

AsahiKASEI

スペクトルシミュレーション

◆XPS価電子帯スペクトル 状態密度 × 光イオン化断面積

①構造最適化した構造で状態密度を計算
C2s
C2p
H1s
Si3s
Si3p
1486.6 eV の場合

②光イオン化断面積で補正
空軌道

◆NEXAFSスペクトル

①非等価な原子についてそれぞれ内殻正孔を導入してNEXAFSスペクトルを計算。
②分子中の非等価な炭素の寄与を原子数で重みづけし、線形結合する。

Intensity / a.u.
Energy / eV
<計算方法>
同一基質計算ツール: CASTEP
外側数: GGA_PBE
内殻: GGA_PBE on the fly pp
k点: 7×7×1
hbar: 750 eV

7

